Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/007492

International filing date: 13 April 2005 (13.04.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-129917

Filing date: 26 April 2004 (26.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 16 June 2005 (16.06.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

25.5.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 4月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-129917

[ST. 10/C]:

[JP2004-129917]

出 願 人
Applicant(s):

昭和電工株式会社

2005年 3月11日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 1) 11)



【書類名】 特許願 【整理番号】 1043648 平成16年 4月26日 【提出日】 特許庁長官 今井 康夫 殿 【あて先】 【国際特許分類】 C07C 17/38 【発明者】 昭和電工株式会社 ガス・化 【住所又は居所】 神奈川県川崎市川崎区扇町5-1 成品事業部 生産・技術統括部内 大野 博基 【氏名】 【特許出願人】 【識別番号】 000002004 【氏名又は名称】 昭和電工株式会社 【代理人】 【識別番号】 100099759 【弁理士】 【氏名又は名称】 青木 篤 【電話番号】 03-5470-1900 【選任した代理人】 【識別番号】 100077517 【弁理士】 【氏名又は名称】 石田 敬 【選任した代理人】 【識別番号】 100086276 【弁理士】 【氏名又は名称】 吉田 維夫 【選任した代理人】 【識別番号】 100087413 【弁理士】 【氏名又は名称】 古賀 哲次 【選任した代理人】 【識別番号】 100082898 【弁理士】 【氏名又は名称】 西山 雅也 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 209382 【納付金額】 16,000円 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】 【物件名】 明細書 1 【物件名】 要約書 1

0200971

【包括委任状番号】

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

【請求項2】

前記ゼオライトのSi/Al比が2以下である請求項1に記載の1, 1-ジクロロエタンの精製方法。

【請求項3】

前記ゼオライトが、モレキュラーシーブス4A、モレキュラーシーブス5A、モレキュラーシーブス10Aおよびモレキュラーシーブス13Xからなる群より選ばれる少なくとも1種のゼオライトである請求項1または2に記載の1, 1 - 50 -0 -0 -0 大変の特製方法

【請求項4】

前記炭素質吸着剤が、モレキュラーシービングカーボン4Aおよび/またはモレキュラーシービングカーボン5Aである請求項1に記載の1,1-ジクロロエタンの精製方法。

【請求項5】

安定剤としてニトロ基および/または水酸基を有する化合物を含む 1 、 1-ジクロロエタンを、前記ゼオライトおよび/または前記炭素質吸着剤と接触させる温度が<math>-20~+60 の範囲である請求項 1~4 のいずれかに記載の 1 、 1-ジクロロエタンの精製方法

【請求項6】

安定剤としてニトロ基および/または水酸基を有する化合物を含む 1 、1-ジクロロエタンを、前記ゼオライトおよび/または炭素質吸着剤と接触させる圧力が $0\sim 1$ MP aの範囲である請求項 $1\sim 5$ のいずれかに記載の 1 、1-ジクロロエタンの精製方法。

【請求項7】

請求項 $1\sim6$ のいずれかに記載の精製方法を用いて得られる、安定剤として含まれるニトロ基および/または水酸基を有する化合物が低減された1, 1 — ジクロロエタンを反応原料として用いる1, 1 — ジフルオロエタンの製造方法。

【請求項8】

次の3つの工程を含むことを特徴とする1,1-ジフルオロエタンの製造方法。

- (1)請求項1~6のいずれかに記載の精製方法を用いて1,1-ジクロロエタン中に安 定剤として含まれるニトロ基および/または水酸基を有する化合物を低減する工程、
- (2) (1) の工程を経て前記ニトロ基および/または水酸基を有する化合物が低減された1,1-ジクロロエタンを、フッ素化触媒の存在下に、フッ化水素と気相で反応させて主として1,1-ジフルオロエタンを含む混合ガスを得る工程、および
- (3) (2) の工程で得られた主として1, 1-ジフルオロエタンを含む混合ガスを分離し、未反応物の少なくとも一部を工程(2)に循環する工程。

【請求項9】

【請求項10】

【請求項11】

ニトロ基および/または水酸基を有する化合物が、ニトロメタン、ニトロエタン、ニトロクレゾール、ニトロトルエン、ニトロフェノール、フェノール、クレゾール、2,6-

ジーブチルーp-クレゾールおよびアミノメチルフェノールからなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物である請求項 $7\sim10$ のいずれかに記載の1,1-ジフルオロエタンの製造方法。

【請求項12】

前記(2)の工程で用いるフッ素化触媒が、Cu、Mg、Zn、Pb、Cr、Al、In、Bi、CoおよびNiからなる群より選ばれる少なくとも1種の元素を含み、接触温度が<math>100~350である請求項8に記載の1, 1-ジフルオロエタンの製造方法。

【請求項13】

前記 (3) の工程で工程 (2) に循環される未反応物が、1-クロロ-1-フルオロエタン、1, 1-ジクロロエタンおよびフッ化水素からなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物である請求項8に記載の<math>1, 1-ジフルオロエタンの製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】1,1-ジクロロエタンの精製方法およびその方法を用いる1,1-ジフルオロエタンの製造方法

【技術分野】

[0001]

本発明は1,1-ジクロロエタンの精製方法およびその方法を用いる1,1-ジフルオロエタンの製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

- 1, 1-ジクロロエタン (CH_3 $CHCl_2$) の製造方法としては、例えば、
- (1) アセチレンと塩化水素との反応により塩化ビニル($CH_2 = CHCI$)を合成し、さらに塩化水素を付加する方法、
- (2) アセトアルデヒドに五塩化リンを作用させる方法

等が知られている。これらの方法では、その製造工程や製品の安定性を確保するため、安定剤が、一般には数百~数千質量 p p mの量で、添加される。

[0003]

一方、例えば、1, 1 ージクロロエタンを原料として用いて製造される1, 1 ージフルオロエタン(CH_3 CHF_2)は、例えば、低温用冷媒やエッチングガスとして注目されている。

[0004]

- 1,1-ジフルオロエタンの製造方法や精製方法としては、従来より、次のような方法が知られている。例えば、
- (3)塩素化フッ素化炭化水素を、触媒の存在下に、水素で還元して製造する方法(特開平7-126197号)、
- (4) 1, 1-ジクロロエタンとフッ化水素とを触媒の存在下に反応させて製造する方法 (特開平6-228021号)

等である。

[0005]

例えば、上記(3)、(4)の方法を用いて製造された1,1ージフルオロエタンには、製造の間に発生するハイドロカーボン(HC)類、ハイドロクロロカーボン(HCC)類、クロロフルオロカーボン(CFC)類、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)類、ハイドロフルオロカーボン(HFC)類の飽和化合物や不飽和化合物等を含む様々な不純物が含まれる。

[0006]

[0007]

しかしながら、1,1-ジクロロエタン中に含まれる安定剤は、例えば、1,1-ジフルオロエタンを製造する際に用いられる触媒の活性劣化の原因となり、触媒寿命が短くなる等の問題が生じるので、かかる安定剤を含まないことが望ましい。

[0008]

そこで、例えば、反応前に安定剤を除去すればよいのであるが、従来の分別蒸留等による除去方法は、操作が煩雑であり、多額の費用を要するという問題がある。

[0009]

【特許文献1】特開平7-126197号公報 【特許文献2】特開平6-228021号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0010]

本発明は、このような背景の下になされたものであって、1, 1 ージクロロエタン中に含まれる安定剤を除去することができ、操作が容易で工業的に実施可能な1, 1 ージクロロエタンの精製方法と、この精製方法を用いる1, 1 ージフルオロエタンの製造方法を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

$[0\ 0\ 1\ 1]$

$[0\ 0\ 1\ 2\]$

したがって、本発明は、例えば、以下の〔1〕~〔13〕に示される1,1-ジクロロエタンの精製方法および該精製方法を用いる1,1-ジフルオロエタンの製造方法を提供する。

[0013]

[1] 安定剤としてニトロ基および/または水酸基を有する化合物を含む 1, 1- ジクロロエタンを、平均細孔径が 3. $4\sim1$ 1 Åの範囲であるゼオライトおよび/または平均細孔径が 3. $4\sim1$ 1 Åの範囲である炭素質吸着剤と液相で接触させ、前記安定剤を低減させることを特徴とする 1, 1- ジクロロエタンの精製方法。

[0014]

[2] 前記ゼオライトのSi/A1比が2以下である上記 [1] に記載の1, 1-ジクロロエタンの精製方法。

[0015]

[3] 前記ゼオライトが、モレキュラーシーブス4A、モレキュラーシーブス5A、モレキュラーシーブス10Aおよびモレキュラーシーブス13Xからなる群より選ばれる少なくとも1種のゼオライトである上記[1]または[2]に記載の1, 1-ジクロロエタンの精製方法。

[0016]

[4] 前記炭素質吸着剤が、モレキュラーシービングカーボン 4A および/またはモレキュラーシービングカーボン 5A である上記 [1] に記載の 1, 1 - ジクロロエタンの精製方法。

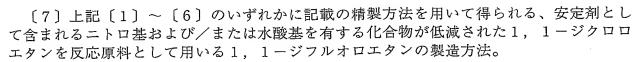
[0017]

[5] 安定剤としてニトロ基および/または水酸基を有する化合物を含む 1 , 1- ジクロロエタンを、前記ゼオライトおよび/または前記炭素質吸着剤と接触させる温度が - 20~+60 $\mathbb C$ の範囲である上記[1]~[4] のいずれかに記載の 1 , 1- ジクロロエタンの精製方法。

[0018]

[6] 安定剤としてニトロ基および/または水酸基を有する化合物を含む 1, 1-ジクロロエタンを、前記ゼオライトおよび/または炭素質吸着剤と接触させる圧力が $0\sim 1$ M P a の範囲である上記 [1] \sim [5] のいずれかに記載の 1, 1-ジクロロエタンの精製方法。

[0019]



[0020]

- [8]次の3つの工程を含むことを特徴とする1,1ージフルオロエタンの製造方法。 (1)上記 [1] \sim [6]のいずれかに記載の精製方法を用いて1,1ージクロロエタン中に安定剤として含まれるニトロ基および/または水酸基を有する化合物を低減する工程
- (2)(1)の工程を経て前記ニトロ基および/または水酸基を有する化合物が低減された1,1-ジクロロエタンを、フッ素化触媒の存在下に、フッ化水素と気相で反応させて主として1,1-ジフルオロエタンを含む混合ガスを得る工程、および
- (3) (2) の工程で得られた主として1, 1ージフルオロエタンを含む混合ガスを分離し、未反応物の少なくとも一部を工程(2)に循環する工程。

[0021]

[9]前記(1)の工程を経た、前記ニトロ基および/または水酸基を有する化合物の総量が30質量ppm以下に低減された1,1-ジクロロエタンを用いて工程(2)を行なう上記[8]に記載の1,1-ジフルオロエタンの製造方法。

[0022]

[10]前記(1)の工程を経た、前記ニトロ基および/または水酸基を有する化合物の総量が10質量ppm以下に低減された1,1-ジクロロエタンを用いて工程(2)を行なう上記[8]に記載の1,1-ジフルオロエタンの製造方法。

[0023]

[11] ニトロ基および/または水酸基を有する化合物が、ニトロメタン、ニトロエタン、ニトロクレゾール、ニトロトルエン、ニトロフェノール、フェノール、クレゾール、2, 6-ジーブチルーp-クレゾールおよびアミノメチルフェノールからなる群より選ばれる少なくとも1種の化合物である上記[7]~[10]のいずれかに記載の1, 1-ジフルオロエタンの製造方法。

[0024]

〔12〕前記(2)の工程で用いるフッ素化触媒が、Cu、Mg、Zn、Pb、Cr、Al、In、Bi、CoおよびNiからなる群より選ばれる少なくとも1種の元素を含み、接触温度が<math>100~350 である上記〔8〕に記載の1,1 ージフルオロエタンの製造方法。

[0025]

[13] 前記(3) の工程で工程(2) に循環される未反応物が、1-クロロー1-フルオロエタン、1, 1-ジクロロエタンおよびフッ化水素からなる群より選ばれる少なくとも 1 種の化合物である上記[8]に記載の1, 1-ジフルオロエタンの製造方法。

【発明の効果】

[0026]

本発明によれば、安定剤を含む 1, 1-ジクロロエタンから簡便な方法で効率よく安定剤を除去し、触媒の劣化等を防止することができ、経済的に 1, 1-ジフルオロエタンを製造することができ、得られた 1, 1-ジフルオロエタンは低温用冷媒やエッチングガスとして使用することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0027]

以下、本発明の好ましい態様について詳しく説明する。

前述したように、1,1-ジクロロエタンの製造方法としては、例えば、(1)アセチレンと塩化水素との反応で塩化ビニルを合成し、さらに塩化水素を付加する方法、(2)アセトアルデヒドに五塩化リンを作用させる方法等が知られているが、前述の理由等により数百~数千質量ppm程度の安定剤が含まれており、安定剤は微量であっても触媒活性劣化原因となるため、反応を行なう前にできる限り低減することが望ましい。

[0028]

本発明者は、操作が容易で経済的で工業的に実用可能である、1, 1-ジクロロエタン中に含まれる安定剤を低減する方法を開発すべく鋭意検討した結果、安定剤を含む1, 1-ジクロロエタンを平均細孔径が3. 4-1 Åである炭素質吸着剤と液相で接触させることにより、安定剤を低減することができることを見出した。

[0029]

本発明の1, 1-ジクロロエタンの精製方法に用いられるゼオライトは、3. $4\sim11$ Å、好ましくは3. $4\sim10$ Åの平均細孔径を有するものであるのがよい。平均細孔径が 11 Åより大きいゼオライトでは、1, 1-ジクロロエタンの吸着量が多くなり、平均細孔径が 3. 4 Åより小さいゼオライトでは安定剤を吸着する能力が小さくなる。

[0030]

また、ゼオライトのSi(シリカ)/A1(アルミニウム)比は2以下であることが好ましく、Si/A1比が2より大きい場合には、安定剤が選択的に吸着されないことがある。ゼオライトとしては、モレキュラーシーブス4A(MS-4A)、モレキュラーシーブス5A(MS-5A)、モレキュラーシーブス10X(MS-10A)およびモレキュラーシーブス13X(MS-13X)からなる群より選ばれる少なくとも1種のゼオライトが好ましい。これらのゼオライトを用いることにより、1,1-ジクロロエタン中の水分も同時に低減することができる。水分を含有するまま加熱するとアセトアルデヒドを生じるため、好ましくない。

[0031]

[0032]

ゼオライトと炭素質吸着剤は、吸着剤の再生を考慮すればそれぞれ単独で使用することが好ましいが、混合して使用することもできる。ゼオライトと炭素質吸着剤を混合する割合は特に制限はないが、1,1-ジクロロエタン中の水分を低減することも考慮すると、混合比はゼオライトに富む比率が好ましい。

[0033]

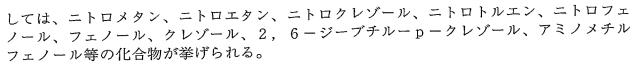
安定剤を含む1, 1-ジクロロエタンを、ゼオライトおよび/または炭素質吸着剤と液相で接触させる方法としては、回分式、連続式等の公知の方法を用いることができる。工業的には吸着剤を固定床にて連続的に流通させる方法が好ましく、液体基準の空間速度(LHSV)は安定剤の濃度および1, 1-ジクロロエタンの処理量により適宜選択できるが、通常は1~80Hr $^{-1}$ の範囲が好ましい。また、1, 1-ジクロロエタン中の安定剤を低減する方法を工業的に実施するためには、吸着塔を2塔設け、それらを交互に切り替えて連続的に精製を行う方法を用いてもよい。

[0034]

1, 1-ジクロロエタンを液相で精製する際の処理温度としては、-20~+60 ℃の範囲が好ましく、0~50 ℃の範囲がより好ましい。処理温度が60 ℃より高いと装置の加熱や耐圧等の点で設備費が増大することになり、-20 ℃より低い温度では冷却設備等が必要となる等の問題がある。また、圧力は0~1 MP a の範囲が好ましく、0~0. 6 MP a の範囲がより好ましい。圧力が1 MP a より大きい場合には、設備の耐圧等の点で経済的に不利となる。

[0035]

以上に説明したように、本発明の精製方法を用いることにより、1,1-ジクロロエタン中に含まれる安定剤を低減することができる。本発明の精製方法は、特に、ニトロ基および/または水酸基を有する化合物からなる安定剤に対して好ましく用いられ、安定剤と



[0036]

本発明の方法に従い、安定剤を含む 1, 1-ジクロロエタンと前記のゼオライトおよび / または炭素質吸着剤とを、液相で、前記の条件下で接触させることにより、例えば、安定剤の総量が 3 0 質量 p p m以下に低減された 1, 1-ジクロロエタンを得ることができる。また、好ましくは安定剤の総量が 1 0 質量 p p m以下に低減された 1, 1-ジクロロエタン、さらに好ましくは安定剤の総量が 5 質量 p p m以下に低減された 1, 1-ジクロロエタンを得ることも可能である。

[0037]

次に、本発明の1,1-ジフルオロエタンの製造方法について説明する。

[0038]

本発明の1, 1-ジフルオロエタンの製造方法は、次の3つの工程を含むことを特徴と する。すなわち、

- (1) 前記の精製方法を用いて1, 1-ジクロロエタン中に安定剤として含まれるニトロ基および/または水酸基を有する化合物を低減する工程、
- (2) (1) の工程を経て前記ニトロ基および/または水酸基を有する化合物が低減された1, 1-ジクロロエタンを、フッ素化触媒の存在下に、フッ化水素と気相で反応させて主として1, 1-ジフルオロエタンを含む混合ガスを得る工程、および
- (3) (2) の工程で得られた主として1, 1-ジフルオロエタンを含む混合ガスを分離し、未反応物の少なくとも一部を工程(2)に循環する工程である。

[0039]

(1) の工程を経て得られた1, 1-ジクロロエタンは、前記ニトロ基および/または水酸基を有する化合物の総量が30質量ppm以下に低減された1, 1-ジクロロエタンであることが好ましく、さらに好ましくは前記ニトロ基および/または水酸基を有する化合物の総量が10質量ppm以下に低減されているのがよく、特に好ましくは前記ニトロ基および/または水酸基を有する化合物の総量が5質量ppm以下に低減されているのがよい。ニトロ基および/または水酸基を有する化合物の総量が30質量ppm以下に低減された1, 1-ジクロロエタンを原料として1, 1-ジフルオロエタンを製造すると、製造工程で使用する触媒の長寿命化が図れ、効率的かつ経済的に主として1, 1-ジフルオロエタンを含む混合物を製造することができる。

[0040]

製造工程で使用するフッ素化触媒としては、Cu、Mg、Zn、Pb、Cr、Al、In、Bi、CoおよびNiからなる群より選ばれる少なくとも1種の元素を含む担持型触媒または塊状型触媒が好ましい。より好ましくは、三価の酸化クロムを主成分とする担持型触媒または塊状型触媒である。反応温度は<math>100~350℃が好ましく、より好ましくは150~300℃である。反応圧力は0~1MPaが好ましく、フッ化水素と1,1-5000円エタンのモル比(150円 120 は150~100 で 100 で 1

[0041]

前記の反応工程で得られた主として1, 1-ジフルオロエタンを含む混合物は蒸留精製工程に導かれ、蒸留精製工程では主として塩化水素と1, 1-ジフルオロエタンの低沸留分と主として未反応物や中間体であるフッ化水素、1, 1-ジクロロエタン、1-クロロー1-フルオロエタンの高沸留分に分離される。そして、低沸留分は塩化水素と目的物である1, 1-ジフルオロエタンに分離される。一方、高沸留分である主としてフッ化水素、1, 1-ジクロロエタンおよび1-クロロ-1-フルオロエタンの少なくとも一部は反応工程に循環して再利用される。

【実施例】

[0042]

以下、実施例および比較例により本発明をさらに説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではない。

[0043]

原料例1

市販の1, 1-ジクロロエタンをガスクロマトグラフ(カラム:キャピラリー式/FID)で分析したところ、安定剤としてニトロメタン(CH_3NO_2)が1091質量ppm含まれ、また水分計(カールフィシャー型)にて水分を分析したところ 46質量ppm含まれており、1, 1-ジクロロエタンの純度は99.76質量%であった。

[0044]

原料例2

市販の1, 1-ジクロロエタンを原料例1と同様にして分析したところ、安定剤としてフェノールが含まれ、その含有量は542質量ppmであり、また水分が56質量ppm含まれており、1, 1-ジクロロエタンの純度は99. 84質量%であった。

[0045]

実施例1

内容積 200m1のステンレス製シリンダーに、ゼオライト [モレキュラーシープス5A(ユニオン昭和株式会社製:平均細孔径 <math>4.2Å、Si/A1比=1)] を 30 g 充填した。ゼオライトを真空乾燥後、シリンダーを冷却しながら、原料例 1 に示した 1,1 ジクロロエタンを 100 g 充填し、温度を 18 \mathbb{C} (室温) に保ちながら時々撹拌し、約 6 時間後に液相部の一部を採取し、前記のガスクロマトグラフおよび水分計にて分析した。

その結果、1,1-ジクロロエタン中の安定剤であるニトロメタンは3質量ppmに低減されており、また含まれる水分は2質量ppm以下であった。

[0046]

実施例2

吸着剤としてゼオライト [モレキュラーシーブス13X(ユニオン昭和株式会社製:平均細孔径10Å、S i / A l 比=0. 8 1)] を 20 g 充填した以外は実施例 1 と同様な操作および条件で処理し、分析を行った。その結果、1, 1-ジクロロエタン中に含まれる安定剤のニトロメタンは 1 質量 p p m以下であった。

[0047]

実施例3

内容積 200m1 のステンレス製シリンダーに、炭素質吸着剤〔モレキュラーシービングカーボン 5A(武田薬品工業株式会社製:平均細孔径 5A)〕を 20g 充填し、真空乾燥後、シリンダーを冷却しながら、原料例 1 に示した 1 、1 ージクロロエタンを 90g 充填した。温度を 20 \mathbb{C} (室温)に保ちながら時々撹拌し、約 4 時間後に液相部の一部を採取して前記のガスクロマトグラフ条件下で分析した。その結果、1 、1 ージクロロエタン中の安定剤であるニトロメタンは 13 質量 p p mに低減されていた。

[0048]

比較例1

吸着剤としてゼオライト [モレキュラーシープスXH-9 (ユニオン昭和株式会社製: 平均細孔径3.2Å、Si/Alk=1)]を30g充填した以外は実施例1と同様な操作および条件で処理し、分析を行った。その結果、1,1ージクロロエタン中に含まれる安定剤のニトロメタンは1068質量ppmであり、低減効果はほとんど認められなかった。

[0049]

比較例 2

吸着剤として炭素質吸着剤〔活性炭:粒状白さぎKL(武田薬品工業株式会社製:平均細孔径35Å)〕を20g充填した以外は実施例3と同様な操作および条件で処理し、分析を行った。その結果、1, 1-ジクロロエタン中の安定剤であるニトロメタンは殆ど吸着されておらず、吸着熱での副反応によるアセトアルデヒド等の新たな分解生成物が検出された。

[0050]

実施例4

内容積 200m1のステンレス製シリンダーに吸着剤として実施例 2 に記載したモレキュラーシーブス 13 X を 15 g と、実施例 3 に記載したモレキュラーシービングカーボン 5 A を 10 g 混合して充填した。シリンダー中の吸着剤を真空乾燥後、シリンダーを冷却しながら、原料例 1 に示した 1 、 1 - ジクロロエタンを 1 00 g 充填し、温度を 2 0 $\mathbb C$ に保ちながら時々撹拌し、約 6 時間後に液相の一部を採取して前記のガスクロマトグラフ条件下で分析を行った。その結果、1 、1 - ジクロロエタン中の安定剤であるニトロメタンは 1 質量 1 p m以下であった。

[0051]

実施例5

原料例 2 に示した安定剤としてフェノールを含有する 1 , 1 - ジクロロエタンを用いた以外は実施例 1 に示した吸着剤を用い、実施例 1 と同様な操作および条件で処理し、分析を行った。その結果、1 , 1 - ジクロロエタン中に含まれる安定剤であるフェノールは 1 質量 p p m以下に低減され、また水分も 3 p p m以下であった。

[0052]

実施例6

内容積 2 Lのステンレス製シリンダーにモレキュラーシーブス 1 3 X (MS-1 3 X) を 1. 9 0 L 充填し、原料例 1 に示した 1, 1 - ジクロロエタンを 2 0 $\mathbb C$ 、圧力 0. 2 M P a の条件下で液相で 3 L / h r の線速で連続供給した。供給開始後、約 3 時間後の出口液中の分析を行った。 1, 1 - ジクロロエタン中の安定剤であるニトロメタンは 2 質量 p p m以下であり、この出口液を別容器に捕集した。

[0053]

[0054]

比較例3

三価の酸化クロムを主成分とする触媒 $80\,\mathrm{m}\,1$ が充填されている内径 $14\,\mathrm{m}\,7$ 大長さ $1\,\mathrm{m}\,6$ $10\,\mathrm{m}\,6$ $10\,\mathrm{m$

【産業上の利用可能性】

[0055]

本発明によれば、低温用冷媒やエッチングガスとして使用することができる、1,1-ジフルオロエタンを工業的に有利に製造することができる。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 1, 1-ジクロロエタン中に含まれる安定剤を除去することができ、操作が容易で工業的に実施可能な1, 1-ジクロロエタンの精製方法およびこれを用いる1, 1-ジフルオロエタンの製造方法を提供する。

【選択図】 なし

特願2004-129917

出願人履歴情報

識別番号

[000002004]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月27日

変更理由」

新規登録

住 所

東京都港区芝大門1丁目13番9号

氏 名 昭和電工株式会社